

第51回：理研シンポジウム マイクロファブリケーション研究の最新動向
～光学素子の超平滑化加工、トライボコーティング技術、表面周期構造の研削加工～
同時開催：第10回板橋オプトフォーラム

開催日時：令和5年10月5日(木)

開催場所：板橋区立グリーンホール

開催形態：ハイブリッド開催 ※WEB参加の方には参加登録後に接続情報が通知されます。

共催：板橋区、国立大学法人宇都宮大学オプティクス教育研究センター、日本光学会

協賛：板橋区産業振興公社、公益社団法人精密工学会、公益社団法人砥粒加工学会、一般社団法人電気加工学会、
一般社団法人日本塑性加工学会、公益社団法人日本セラミックス協会、一般社団法人日本機械学会、一般社団法人
日本オプトメカトロニクス協会光部品生産技術部会

—————プログラム—————

10:30～10:35

1. 主旨説明

理化学研究所 大森素形材工学研究室 大森 整 氏

第一部：特別セッション

10:35～11:00

2. 微細加工関連の最新研究動向

—MIRAI会議にみるマイクロ・トライボファブリケーション事例—

理化学研究所 大森素形材工学研究室 大森 整 氏

11:00～12:00

3. 超精密加工が拓いたX線光学、高速X線撮像が拓く精密加工学

—原子レベル超精密加工法とX線による加工現象解析—

東京大学大学院/理化学研究所 三村秀和 氏

13:00～13:05

4. IOF開会の挨拶

板橋区長 坂本 健 氏

13:05～14:10

5. 【基調講演】理研小型中性子源システム RANS プロジェクトの現状

—橋梁内部の塩分現場検出、劣化可視化の実現、応力計測へむけて—

理化学研究所 中性子ビーム技術開発チーム 大竹 淑恵 氏

14:10～14:30 休憩

第二部：トライボセッション

14:30～15:30

6. 株式会社オンワード技研の会社概要とコーティング技術について

株式会社オンワード技研 川島丈志 氏

15:30～16:00 休憩

第三部：マイクロセッション

16:00～17:00

7. 表面周期構造のELID研削加工について—表面機能を目指したシリンドリカル周期構造の創成—

理化学研究所 大森素形材工学研究室 白 楽天 氏

17:00～17:10 総合質疑・総括

理化学研究所 大森素形材工学研究室 大森 整 氏

17:10～17:20

8. 次回予定、閉会の挨拶

理化学研究所 大森素形材工学研究室 大森 整 氏

参加ご希望の方は、ご所属、ご住所、ご芳名、ご連絡先（TEL, FAX, E-mail）、現地参加/WEB参加の別を記載の上、
E-mail: micro@e-micro.org までお申し込みください。

本シンポジウムは、理研シンポジウムの一環として行われています。